PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11138971 A

(43) Date of publication of application: 25 . 05 . 99

(51) Int. CI

B41M_1/06

B41C 1/10

B41N 1/10

G03F 7/00

G03F 7/004

(21) Application number: 09308823

(22) Date of filing: 11 . 11 . 97

(71) Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(72) Inventor:

NAKAYAMA TAKAO KAMIYAMA KOJI YAMADA TAKASHI

(54) METHOD FOR OFFSET PRINTING AND OFFSET PRINTING ORIGINAL PLATE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a printing image surface of a quality of a high identifiability between an image part and a non-image part without necessity of an alkali developer liquid by utilizing a phenomenon in which a specific metal oxide changes in hydrophilic property of a surface by emitting a light and a property in which the changed hydrophilic property is returned to an original by a heat treatment.

SOLUTION: A thin layer made of single or a combination of two or more types of photocatalytic metal oxides made of RTiO₃, AB_{2x}C_xD_{3x}E_xO₁₀SnO₂, Bi₂O₃, and

Fe₂O₃ (wherein R is an alkali earth metal atom, A is a hydrogen atom or an alkali metal atom. C is a rare earth element atom, D is a group 5A metal atom, E is a group 4A metal atom, and x is a numeric value of 0 to 2) is provided as a photosensitive layer on a surface of a printing original plate. The method comprises the steps of conducting an image-like exposure by using an active light, generating an image-like hydrophilic part on the exposure surface, and then, bringing the surface into contact with a printing ink to form a printing surface for receiving the image area with the ink. Thus, a simple printing without necessity of executing an additional operation for enhancing sensitization properties.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-138971

(43)公開日 平成11年(1999)5月25日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号		FΙ			•		
B41M	1/06			B41M	1/06				
B41C	1/10			B41C	1/10				
B41N	1/10			B41N	1/10				
G03F	7/00	5 0 3		G 0 3 F	7/00	503			
	7/004	5 2 1			7/004	521			
				審査請求	衣籠未	き 請求項の数3	OL	(全 8	頁)
(21)出願番号	特願平9-308823			(71) 出願人	000005201				
					富士写	アロスルム株式:	会社		
(22)出顧日		平成9年(1997)11月11日			神奈川	県南足柄市中沼2	210番地		
				(72)発明者	中山	隆雄			
		•			静岡県	棒原郡吉田町川	元4000番	地富	士写
					真フイ	ルム株式会社内			•
				(72)発明者	前 神山	宏二			
		·			神奈川	県足柄上郡開成	叮宮台79	8番地	富
					士写真	フイルム株式会	生内		
			. '	(72)発明者	田山	· 隆			
				•	神奈川	県足柄上郡開成	订宫台79	8番地	當
	•				士写真	フイルム株式会	吐内		
				(74)代理人	、弁理士	获野 平 (3	小3名)	*	
		•							

(54) 【発明の名称】 オフセット印刷方法及びオフセット印刷用原板

(57)【要約】

【課題】アルカリ現像液を必要とせず、画像部と非画像部の識別性が高く、優れた画質の印刷画面を作りうるオフセット印刷方法を提供する。

【解決手段】表面が活性光の照射によって親水性に変化する性質を有する特定の構造の金属酸化物の薄層を有する印刷用原版に活性光を用いて像様露光を行い、画像領域がインクを受け入れた印刷面を形成させて印刷を行うことを特徴とする印刷方法。

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】 RTiO, (Rはアルカリ土類金属原子)、AB_{x-x} C_x D_{y-x} E_x O₁₀ (Aは水素原子又はアルカリ金属原子、Bはアルカリ土類金属原子又は鉛原子、Cは希土類原子、Dは周期律表の5A族元素に属する金属原子、Eは同じく4A族元素に属する金属原子、xは0~2の任意の数値を表す)、SnO_x , Bi_x O_y 及びFe_x O_y の少なくとも一つからなる薄層を有する印刷用原版に該化合物を励起させる活性光を用いて像様露光を行い、露光面を印刷用インクに接触させて、画 10像領域がインクを受け入れた印刷面を形成させ、該印刷面を印刷される面と接触させてインクを転写することによって印刷を行うことを特徴とするオフセット印刷方法。

【請求項2】 オフセット印刷機の版胴の印刷面側の表面に請求項1に記載の薄層を設けたことを特徴とする請求項1に記載のオフセット印刷方法。

【請求項3】 印刷面側の表面に請求項1に記載の薄層を有し、請求項1又は2に記載のオフセット印刷方法に用いることを特徴とするオフセット印刷用原板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一般軽印刷分野、 とりわけオフセット印刷、特に簡易に印刷版を製作でき る新規なオフセット印刷方法及び印刷版に関するもので ある。

[0002]

【従来の技術】オフセット印刷法は、数多くの印刷方法の中でも印刷版の製作工程が簡単であるために、とくに一般的に用いられてきており、現在の主要な印刷手段となっている。この印刷技術は、油と水の不混和性に基づいており、画像領域には油性材料つまりインクが、非画像領域には湿し水が選択的に保持される。したがって印刷される面と直接あるいはブランケットと称する中間体を介して間接的に接触させると画像部のインクが転写されて印刷が行われる。

【0003】オフセット印刷の主な方法は、アルミニウム基板を支持体としてその上にジアソ感光層を塗設した PS板である。PS板においては、アルミニウム基板を 支持体としてその表面を砂目立て、陽極酸化、その他の 40 諸工程を施してインク受容能と非画像部のインク反発性 を強め、耐刷力を向上させ、印刷面の精彩化を図るなど を行い、その表面に印刷用画像を形成させる。したがってオフセット印刷は、簡易性に加えて耐刷力や印刷面の 高精彩性などの特性も備わってきている。しかしなが ら、印刷物の普及に伴って、オフセット印刷法の一層の 簡易化が要望され、数多くの簡易印刷方法が提案されて いる。

【0004】その代表例がAgfa-Gevaert社から市販されたCopyrapid オフセット印刷版をはじめ、米国特許35

11656号、特開平7-56351号などでも開示されている銀塩拡散転写法による印刷版作製に基づく印刷方法であって、この方法は、1工程で転写画像を作ることができて、かつその画像が親油性であるために、そのまま印刷版とすることができるので、簡易な印刷方法として実用されている。しかしながら、簡易とはいいながらこの方法もアルカリ現像液による拡散転写現像工程を必要としている。現像液による現像工程を必要としないさらに簡易な印刷方法が要望されている。

2

【0005】画像露光を行ったのちのアルカリ現像液による現像工程を省略した簡易印刷版の製作方法の開発は上記の背景から行われてきた。現像工程を省略できることから無処理刷版とも呼ばれるこの簡易印刷版の技術分野では、これまでに主として

⑤像様露光による画像記録面上の照射部の熱破壊による像形成、②像様露光による照射部の親油性化(ヒートモード硬化)による画像形成、③同じく照射部の親油性化であるが、光モード硬化によるもの、④ジアゾ化合物の光分解による表面性質の変化、⑤画像部のヒートモード溶融熱転写などの諸原理に基づく手段が提案されている。

【0006】上記の簡易オフセット印刷方法として開示されている技術には、米国特許第3,506,779号、同第3,549,733号、同第3,574,657号、同第3,739,033号、同第3,832,948号、同第3,945,318号、同第3,962,513号、同第3,964,389号、同第4,034,183号、同第4,081,572号、同第4,693,958号、同第731,317号、同第5,238,778号、同第5,353,705号、同第5,385,092号、同第5,395,729号等の米国特許及び欧州特許第1068号などがある。

【0007】これらは、製版に際して現像液を必要とし ないように考案されているが、親油性領域と親水性領域 との差異が不十分であること、したがって印刷画像の画 質が劣ること、解像力が劣り、先鋭度の優れた印刷画面 が得にくいこと、画像面の機械的強度が不十分で傷がつ きやすいこと、そのために保護膜を設けるなどによって 却って簡易性が損なわれること、長時間の印刷に耐える 耐久性が不十分なことなどのいずれか一つ以上の欠点を 伴っていて、単にアルカリ現像工程を無くすだけでは実 用性は伴わないことを示している。印刷上必要とされる 諸特性を具備し、かつ簡易に印刷版を製作できる印刷版 作成方法への強い要望は、いまだに満たされていない。 【0008】上記した無処理型印刷版作成方法の一つに ジルコニアセラミックが光照射によって親水性化すると とを利用した印刷版作製方法が特開平9-169098 号で開示されている。しかし、ジルコニアの光感度は不 十分であり、かつ疎水性から親水性への光変換効果が不 十分のため画像部と非画像部の識別性が不足している。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明が解決しようとしている第1の課題は、アルカリ性現像液を必要としない簡易性と実用レベルの十分の画質を有し、かつ上記した従来開示された技術に見られる使用上の制約や欠点を伴わないオフセット印刷方法を提供することである。具体的には、第1にアルカリ現像液を必要とせず、第2に画像部と非画像部の識別性が高い画質の印刷画面を作ることができるオフセット印刷方法とそのための印刷原板を提供することである。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明者たちは、上記の目的を達成するために、鋭意検討の結果、特定の金属酸化物が光照射によって表面の親水性が変化する現象と変化した親水性が熱処理によってもとに戻る性質を有することを発見し、この現象を印刷方法の簡易化と印刷版の再利用化に応用して上記の課題を解決できる可能性に着目し、これに基づいて本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、下記の通りである。

【0011】1. RTiO, (Rはアルカリ土類金属原 20子)、AB, C. D, E. O, (Aは水素原子又はアルカリ金属原子、Bはアルカリ土類金属原子又は鉛原子、Cは希土類原子、Dは周期律表の5A族元素に属する金属原子、Eは同じく4A族元素に属する金属原子、xは0~2の任意の数値を表す)、SnO, Bi, O, 及びFe, O, の少なくとも一つからなる薄層を有する印刷用原版に該化合物を励起させる活性光を用いて像様露光を行い、露光面を印刷用インクに接触させて、画像領域がインクを受け入れた印刷面を形成させ、該印刷面を印刷される面と接触させてインクを転写することに 30よって印刷を行うことを特徴とするオフセット印刷方法。

【0012】2. オフセット印刷機の版胴の印刷面側の表面に請求項1に記載の薄層を設けたことを特徴とする上記1に記載のオフセット印刷方法。

【0013】3. 印刷面側の表面に上記1に記載の薄層を有し、上記1又は2に記載のオフセット印刷方法に用いることを特徴とするオフセット印刷用原板。

[0014]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態について詳細に説明する。本発明は、特定の金属酸化物の薄層が活性光の照射を受けてその表面が親水性へと性質を変える特性を有することと、熱によってその変化した表面の性質がもとの性質に戻ることとを発見し、それらの現象をインクの受容性と反撥性の識別へ応用して、それをオフセット印刷方法とその印刷版の作製に応用する技術を確立したことを特徴点としている。

【0015】以下の説明では、本発明に使用する上記の特定の金属酸化物を「光触媒型金属酸化物」と呼ぶ。その詳細を述べる前に、蛇足ながら、本明細書で用いてい 50

る用語について触れておくと、活性光とは、光触媒型金属酸化物が吸収すると励起されて、その表面を親水性に変化させる光を指しており、その光源や波長などの詳細は後述する。また、「像様露光」は、受光面照度が画像状に分布するように変調された画像を版面上に形成するための露光である。以下の説明では「薄膜」と「薄層」を同義に用いている。

【0016】本発明に使用する光触媒型金属酸化物について説明する。RTiO,のRはマグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、ベリリウムなどの周期律表のアルカリ土類元素に属する金属原子であり、とくにストロンチウムとバリウムが好ましい。また、2種以上のアルカリ土類金属原子をその合計が上記の式に化学量論的に整合する限り共存することができる。

【0017】一般式AB_{z-x} C_x D_{j-x} E_x O₁₀で表さ れる化合物において、Aは水素原子及びナトリウム、カ リウム、ルビジューム、セシウム、リチウムなどのアル カリ金属原子から選ばれる1価原子で、その合計が上記 の式に化学量論的に整合する限りそれらの2種以上を共 存してもよい。Bは、上記のRと同義のアルカリ土類金 属原子又は鉛原子であり、上記同様に化学量論的に整合 する限り2種以上の原子が共存してもよい。Cは希土類 原子であり、好ましくは、スカンジウム及びイットリウ ム並びにランタン、セリウム、プラセオジウム、ネオジ ウム、ホルミウム、ユウロピウム、ガドリニウム、テル ビウム、ツリウム、イッテルビウム、ルテチウムなどの ランタノイド系元素に属する原子であり、また、その合 計が上記の式に化学量論的に整合する限りそれらの2種 以上を共存してもよい。Dは周期律表の5A族元素から 選ばれた一種以上で、窒素、リン、ヒ素、アンチモン、 ビスマスが挙げられる。また、化学量論関係を満たす限 り、2種以上の5A族元素の金属原子が共存してもよ い。Eは同じくシリコン、ゲルマニウム、錫、鉛などの 4 A 族元素に属する金属原子であり、また、2 種以上の 4A族の金属原子が共存してもよい。xは0~2の任意 の数値を表す。

【0018】本発明においては、以上のRTiO,、AB_{1-x} C_x D_{1-x} E_x O₁₀、SnO_x , Bi_x O_x 及びFe_x O_y の少なくとも一つを単独あるいは2種以上を組み合わせからなる薄層を感光層として印刷用原版表面に設ける。この薄層は、本来は疎水性(つまり親水性)であるが、活性光の照射によって表面が親水性になる性質を有する。この特性を利用して、活性光を用いて像様露光を行って露光面に像様の親水性部分を生成させたのち、その面を印刷用インクに接触させて、画像領域がインクを受け入れた印刷面を形成させて印刷を行う方法であり、感脂性を高めるための付加的な操作を施す必要のない簡易な印刷を行えるのが本発明のオフセット印刷方法の特徴である。

【0019】上記の金属酸化物が光触媒反応によってそ

の表面が親水性化する現象は、特開平9-70541 号、同9-77535号などで公知であるが、活性光によるこの表面の性質変化を新たな方式のオフセット印刷 に応用するという着想は、新しい技術思想である。

【0020】本発明に使用する上記の光触媒型金属酸化物を原版の表面に設けるには、たとえば、①上記酸化物微粒子の分散物を印刷版の原版上に塗設する方法、②塗設したのち焼成してバインダーを減量或いは除去する方法、③印刷版の原版上に上記酸化物を各種の真空薄膜法で膜形成する方法、④例えば金属元素のアルコレートのような有機化合物を原版上に塗布したのち、加水分解させ、さらに焼成酸化を施して適当な厚みの金属薄膜とする方法、⑤上記金属を含む塩酸塩、硝酸塩などの水溶液を加熱スプレーする方法など、既知の任意の方法を用いることができる。本発明においては、真空蒸着による酸化チタン層が特に好ましい。

【0021】上記の又は②のチタン酸バリウム微粒子を **塗設する方法には、チタン酸バリウムとシリコンの混合** 分散物を塗布して表面層を形成させる方法、チタン酸バ リウムとオルガノポリシロキサンまたはそのモノマーと 20 の混合物を塗布する方法などがある。また、酸化物層の 中に酸化物と共存するできるボリマーバインダーに分散 して塗布することもできる。酸化物微粒子のバインダー には、チタン酸バリウム微粒子に対して分散性を有する ポリマーを広く用いることができる。好ましいバインダ ーポリマーの例としては、ポリエチレンなどのポリアル キレンポリマー、ポリブタジエン、ポリアクリル酸エス テル、ポリメタクリル酸エステル、ポリ酢酸ビニル、ポ リ蟻酸ビニル、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチ レンナフタレート、ポリビニルアルコール、部分鹸化ポ 30 リビニルアルコール、ポリスチレンなどの疎水性バイン ダーが好ましく、それらの樹脂を混合して使用してもよ い。この方法の場合にはチタン酸バリウム以外にチタン 酸マグネシウム、チタン酸カルシウム、チタン酸ストロ ンチウム又はそれらの分子間化合物、混合物も同様に薄 膜形成可能である。

【0022】同様にして \mathbf{O} 、 \mathbf{O} の塗設方法でCs La、Nb T i、 O_{10} 微粒子を塗設することも可能である。Cs La、Nb T i、 O_{10} 微粒子は、その化学量論に対応するCs、Co、Cs、Co、Cs、Co、Cs、Co、Cs La、Co、Cs La、Cs Co、Cs Co、Cs Co、Cs Co、Cs Co、Cs Co、Cs Co Cs Co C

【0023】上記3の真空薄膜形成法を用いた光触媒型 50

金属酸化物層の形成方法としては、一般的にはスパッター リング法あるいは真空薄膜形成法が用いられる。スパッ タリング法では、あらかじめ単体もしくは2元の酸化物 ターゲットを準備する。例えば、チタン酸バリウムター ゲットを用いて蒸着膜用の支持体の温度を450°C以 上に保ち、アルゴン/酸素混合雰囲気中でRFスパッタ リングを行うことによりチタン酸パリウム決勝薄膜が得 られる。結晶性の制御には必要に応じてポストアニーリ ングを300~900°Cで行えばよい。本方法は前述 のRTiO、(Rはアルカリ土類金属原子)をはじめ他 の前記光触媒型金属酸化物にも、結晶制御に最適な基板 温度を調整すれば同様の考え方で薄膜形成が可能であ る。例えば酸化錫薄膜を設ける場合には基板温度120 * C、アルゴン/酸素混合雰囲気中でRFスパッタリン グを行うことによりチタン酸バリウム結晶薄膜が得比5 0/50、RFパワー200Wで本目的に沿う薄膜が得 られる。

【0024】上記 $\mathbf{0}$ の金属アルコレートを用いる方法も、バインダーを使用しないで目的の薄膜形成が可能な方法である。チタン酸バリウムの薄膜を形成するにはバリウムエトキシドとチタニウムブトキシドの混合アルコール溶液を表面にSiO。を有するシリコン基板上に塗布し、その表面を加水分解したのち、 200° C以上に加熱してチタン酸バリウムの薄膜を形成することが可能である。本方式は前述した他のRTiO,(Rはアルカリ土類金属原子)、 AB_{2-x} C、 D_{3-x} Ex O_{3-x} (A.B. C、D、E はそれぞれ前記の定義の内容を表す)、 SnO_3 , Bi_2O ,及びFe 。O,の薄膜形成に適用することができる。

【0025】上記のの光触媒性機能を発現する金属酸化物薄膜を形成する方法も、バインダーを含まない系の薄膜の形成が可能である。SnO。の薄膜を形成するにはSnC1。の塩酸水溶液を200°C以上に加熱した石英又は結晶性ガラス表面に吹きつけて薄膜を生成することができる。本方式は、SnO、薄膜のほか、前述したRTiO、(Rはアルカリ土類金属原子)、AB_{1-x}C、D_{1-x}E、O₁。(A、B、C、D、Eはそれぞれ前記の定義の内容を表す)、Bi、O、及びFe、O、のいずれの薄膜形成にも適用することができる。

【0026】金属酸化物薄膜の厚みは、上記のいずれの場合も1~100000オングストロームがよく、好ましくは10~10000オングストロームである。さらに好ましくは3000オングストローム以下として光干渉の歪みを防ぐのがよい。また、光活性化作用を十分に発現させるには厚みが50オングストローム以上あることが好都合である。

【0027】バインダーを使用した場合の上記光触媒型 金属酸化物の薄層において、金属酸化物の体積率は50~100%であり、好ましくは90%以上を酸化物が占めるのがよく、さらに好ましくは酸化物の連続層つまり

実質的に100%であるのがよい。また、光照射によって表面の親水性が変化する性質を増進させるためにある種の金属をドーピングすることは有効な場合があり、この目的にはイオン化傾向が小さい金属のドーピングが適しており、Pt, Pd, Au, Ag, Cu, Ni, Fe, Coをドーピングするのが好ましい。また、これらの好ましい金属を複数ドーピングしてもよい。

【0028】本発明に係わる印刷版は、いろいろの形態と材料を用いることができる。例えば、印刷機の版胴の表面に光触媒型金属酸化物を蒸着、浸漬あるいは塗布するなど上記した方法で直接酸化物層を設ける方法、金属板の表面に光触媒型金属酸化物層を設けてそれを版胴に巻き付けて印刷版とする方法、その金属板としては、アルミニウム板、ステンレス鋼、ニッケル、銅板が好ましく、また可撓性(フレキシブル)な金属板を用いることが出来る。また、ポリエステル類やセルローズエステルなどのフレキシブルなブラスチック支持体も用いることが出来る。防水加工紙、ポリエチレン積層紙、含浸紙などの支持体上に酸化物層を設けてもよく、それを印刷版として使用してもよい。

【0029】本発明において、光触媒型金属酸化物の層を支持体上に設ける場合、使用される支持体としては、寸度的に安定な板状物であり、例えば、紙、プラスチック(例えば、ボリエチレン、ボリプロピレン、ボリスチレン等)がラミネートされた紙、金属板(例えば、アルミニウム、亜鉛、銅、ステンレス等)、ブラスチックフィルム(例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、がロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ボリエチレンテレフタレート、ボリエチレン、ボリスチレン、ボリプロピレン、ボリカーボネート、ボリビニルアセタール等)、上記のごとき金属がラミネート、もしくは蒸着された紙、もしくはプラスチックフィルム等が含まれる。

【0030】好ましい支持体は、ポリエステルフィル ム、アルミニウム、又は印刷版上で腐食しにくいSUS 板であり、その中でも寸法安定性がよく、比較的安価で あるアルミニウム板は特に好ましい。好適なアルミニウ ム板は、純アルミニウム板およびアルミニウムを主成分 とし、微量の異元素を含む合金板であり、更にアルミニ ウムがラミネートもしくは蒸着されたプラスチックフィ ルムでもよい。アルミニウム合金に含まれる異元素に は、ケイ素、鉄、マンガン、銅、マグネシウム、クロ ム、亜鉛、ビスマス、ニッケル、チタンなどがある。合 金中の異元素の含有量は高々10重量%以下である。本 発明において特に好適なアルミニウムは、純アルミニウ ムであるが、完全に純粋なアルミニウムは精錬技術上製 造が困難であるので、僅かに異元素を含有するものでも よい。このように本発明に適用されるアルミニウム板 は、その組成が特定されるものではなく、従来より公知 公用の素材のアルミニウム板を適宜に利用することがで 50 きる。本発明で用いられる支持体の厚みはおよそ0.05mm~0.6mm程度、好ましくは0.1mm~0.4mm、特に好ましくは0.15mm~0.3mmである。

【003.1】アルミニウム板を粗面化するに先立ち、所 望により、表面の圧延油を除去するための例えば界面活 性剤、有機溶剤またはアルカリ性水溶液などによる脱脂 処理が行われる。アルミニウム板の表面の粗面化処理 は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗 面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法 および化学的に表面を選択溶解させる方法により行われ る。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨 法、ブラスト研磨法、バフ研磨法などの公知の方法を用 いることができる。また、電気化学的な粗面化法として は塩酸または硝酸電解液中で交流または直流により行う 方法がある。また、特開昭54-63902号に開示さ れているように両者を組み合わせた方法も利用すること ができる。この様に粗面化されたアルミニウム板は、必 要に応じてアルカリエッチング処理および中和処理され た後、所望により表面の保水性や耐摩耗性を高めるため に陽極酸化処理が施される。アルミニウム板の陽極酸化 処理に用いられる電解質としては、多孔質酸化皮膜を形 成する種々の電解質の使用が可能で、一般的には硫酸、 塩酸、蓚酸、クロム酸あるいはそれらの混酸が用いられ る。それらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜 決められる。

【0032】陽極酸化の処理条件は用いる電解質により種々変わるので一概に特定し得ないが一般的には電解質の濃度が1~80重量%溶液、液温は5~70℃、電流密度5~60A/dm²、電圧1~100V、電解時間10秒~5分の範囲であれば適当である。陽極酸化皮膜の量は1.0g/m²より少ないと耐刷性が不十分であったり、平板印刷版の非画像部に傷が付き易くなって、印刷時に傷の部分にインキが付着するいわゆる「傷汚れ」が生じ易くなる。

【0033】光触媒型金属酸化物の表面層を有する印刷原版は、本来親油性であり、インクを受容するが、像様露光を行うと光の照射を受けた部分は、親水性となり、インクを受け付けなくなる。したがってこのようにして描画した印刷原版にオフセット印刷用インクに接触させて非画像領域が湿し水を保持し、画像領域がインクを受け入れた印刷面を形成させ、該印刷面を印刷される面と接触させてインクを転写することによって印刷が行われる。

【0034】本発明の基本となっている「光の照射による親油性と親水性の間の変化」はきわめて顕著である。 画像部と非画像部の親水性と親油性の差が大きいほど識別効果が顕著であり、印刷面が鮮明となり、同時に耐刷性も大きくなる。親水性と親油性の相違度は、水滴に対する接触角によって表すことができる。親水性が大きいほど水滴は広がりをみせて接触角が小さくなり、逆に水 福を反発する(はっ水性つまり親油性)場合は接触角が大きくなる。つまり、本発明の光触媒型金属酸化物表面層を有する原版は、本来水に対して高い接触角を有しているが、活性光の照射を受けるとその接触角が急激に低下し、親油性のインクをはじく性質に変化するので、版面上に画像状にインク保持部と水保持部ができて紙などの受像シートと接触することによってその被印刷面にインクが転写される。

【0035】光触媒型金属酸化物を主成分とする薄層を励起させる活性光は、400nm以下に感光域を有する 10ので、水銀灯、タングステンハロゲンランプ、その他のメタルハライドランプ、キセノン灯、その他紫外線光を発する放電管などを用いることが出来る。また、励起光としては、発振波長を325nmに有するヘリウムカドミウムレーザーや発振波長を351、1~363、8nmに有する水冷アルゴンレーザーも用いることができる。さらに近紫外レーザー発振が確認されている窒化ガリウムレーザー系では、発振波長を360~440nmに有するInCaN系量子井戸半導体レーザー、及び360~430nmに発振波長を有する導波路 MQO-LiNDO。反 20転ドメイン波長変換デバイス型のレーザーも適用できる。

【0036】照射光量に応じて、表面層の光触媒型金属 酸化物を光吸収励起によって親水性に変化して行き、表 面層を構成する光触媒型金属酸化物がすべて活性化する とそれ以上の光照射によってさらに親水性の程度が変化 することはない。好ましい照射光の強さは、光触媒型金 属酸化物の画像形成層の性質によって異なり、また活性 光の波長や分光分布によっても異なるが、通常は印刷用 画像で変調する前の面露光強度が0.05~100jo ule/cm², 好ましくは0.05~10joule /cm', より好ましくは0.05~5joule/c m'である。また、光照射には相反則がほぼ成立してお り、例えば10mW/cm゚で100秒の露光を行って も、1W/cm²で1秒の露光を行っても、同じ効果が 得られるので活性光を発光する限り光源の選択には制約 はない。この照射光量は、レーザーによるスキャニング 方式あるいはな発散型光源を用いる面露光方式でもとく に支障がないレベルの光量である。

【0037】上記の疎水性から親水性への光による変化 40をもたらす感光性は、性質及び機構共に従来開示されているジルコニアセラミック(特開平9-169098)の感光性とは異なるものである。たとえば、感度については、ジルコニアセラミックに対しては7W/μm²のレーザー光と記されており、レーザー光のパルス持続時間を100ナノ秒として70joule/cm²であって光触媒型金属酸化物層の感度より約1桁低い。機構的にも、十分解明されてはいないが、親油性有機付着物の光剥離反応と考えられており、ジルコニアの光変化機構とは異なっている。 50

【0038】親油性の光触媒型金属酸化物の表面層へ画像焼き付け露光を行ったのち、印刷原版は現像処理することなく、そのままオフセット印刷工程に送ることができる。従って通常の公知の平版印刷法に比較して簡易性を中心に多くの利点を有する。すなわち上記したようにアルカリ現像液による化学処理が不要であり、それに伴うワイビング、ブラッシングの操作も不要であり、さらに現像廃液の排出による環境負荷も伴わない。

10

【0039】以上のようにして得られた平版印刷版の全 面露光部は十分に親水性化しているが、所望により、水 洗水、界面活性剤等を含有するリンス液、アラビアガム や澱粉誘導体を含む不感脂化液で後処理される。本発明 の画像記録材料を印刷用版材として使用する場合の後処 理としては、これらの処理を種々組み合わせて用いると とができる。その方法としては、該整面液を浸み込ませ たスポンジや脱脂綿にて、平版印刷版上に塗布するか、 整面液を満たしたバット中に印刷版を浸漬して塗布する 方法や、自動コーターによる塗布などが適用される。ま た、塗布した後でスキージー、あるいは、スキージーロ ーラーで、その塗布量を均一にすることは、より好まし い結果を与える。整面液の塗布量は一般に0.03~ 0. 8 g/m² (乾燥重量)が適当である。この様な処理に よって得られた平版印刷版はオフセット印刷機等にかけ られ、多数枚の印刷に用いられる。

[0040]

【実施例】次に実施例により本発明をさらに説明するが、本発明はこれに限定されない。 実施例 1

99.5重量%アルミニウムに、銅を0.01重量%、 チタンを0.03重量%、鉄を0.3重量%、ケイ素を 0. 1重量%含有するJIS A1050アルミニウム 材の厚み0.30mm圧延板を、400メッシュのパミス トン (共立窯業製) の20重量%水性懸濁液と、回転ナ イロンブラシ(6,10-ナイロン)とを用いてその表 面を砂目立てした後、よく水で洗浄した。これを15重 量%水酸化ナトリウム水溶液(アルミニウム4.5重量 %含有) に浸漬してアルミニウムの溶解量が5g/m²にな るようにエッチングした後、流水で水洗した。更に、1 重量%硝酸で中和し、次に0.7重量%硝酸水溶液(ア ルミニウム0.5重量%含有)中で、陽極時電圧10. 5ポルト、陰極時電圧9. 3ポルトの矩形波交番波形電 圧(電流比r=0.90、特公昭58-5796号公報 実施例に記載されている電流波形)を用いて160クロ ーン/cm²の陽極時電気量で電解粗面化処理を行った。 水洗後、35℃の10重量%水酸化ナトリウム水溶液中 に浸漬して、アルミニウム溶解量が1g/m になるように エッチングした後、水洗した。次に、50℃、30重量 %の硫酸水溶液中に浸漬し、デスマットした後、水洗し た。

50 【0041】さらに、35℃の硫酸20重量%水溶液

(アルミニウム 0.8 重量%含有)中で直流電流を用いて、多孔性陽極酸化皮膜形成処理を行った。即ち電流密度 1.3 A/dm² で電解を行い、電解時間の調節により陽極酸化皮膜重量 2.7 g/m² とした。この支持体を水洗後、7.0 *Cのケイ酸ナトリウムの 3 重量%水溶液に 3.0 秒間浸漬処理し、水洗乾燥した。以上のようにして得られたアルミニウム支持体は、マクベス RD 9.2 0 反射濃度計で測定した反射濃度は 0.58 μ mであった。

【0042】次いでこのアルミニウム支持体をスパッタ 10 リング装置内にセットし、5.0x10-7Torrまで真空 排気する。支持体を500°Cに加熱し、Ar/O,が 60/40 (モル比) となるようにガス圧を5 x 10⁻³ Torrに調製した。6インチφのチタン酸バリウムの焼結 ターゲットにRFパワー200Wを投入して膜圧100 0 Aのチタン酸バリウム薄膜を形成した。 X線解析法に よれば、この薄膜は多結晶体であった。サイズを510 ×400mkカットしてサンプルとした。この表面に4 00線/インチのポジの画像を有するリスフィルム原稿 を置き、上から石英ガラス板で機械的に密着させた。と れにウシオ電気社製USIO焼き付け用光源装置ユニレック URM-600形式GH-60201Xを用いて、光強 度25mW/cmプのもとで2分間露光を行った。協和界面科 学株式会社製CONTACT-ANGLE METERCA-Dを用いて空中水 滴法で表面の接触角を測定したところ水に対する(空中 水滴)接触角は露光部7度、非露光部54~56度を得

【0043】このチタン酸バリウム薄膜表面を有する印刷版を、サクライ社製オリバー52片面印刷機にセットし、湿し水を純水、インキを大日本インキ化学工業社製 30 Newchampion F グロス85 墨を用いて1000枚オフセット印刷を行った。スタートから終了まで鮮明な印刷物が得られ、印刷版の損傷もみとめられなかった。

【0044】実施例2

厚さ200ミクロンのポリエチレンテレフタレート(PET)支持体をスパッタリング装置内にセットし、 5×10^{-7} Torrまで真空排気を行った。支持体を 120° Cに加熱してアルゴン/酸素混合ガス(50/50モル比)のガス圧を 5×10^{-7} Torr になるように調節した。6 インチ ϕ S n O、焼結ターゲットにRFパワー150 W 40を投入し、膜圧1000オングストロームの酸化錫の薄膜を形成した。この原板のサイズを 510×400 mmにカットしてサンプルとした。

【0045】との表面にポジの画像を有するリスフィルム原稿を置き、上から石英ガラス板で機械的に密着させた。これにウシオ電気社製USIO焼き付け用光源装置ユニレックURM-600形式GH-60201Xを用いて、光強度25mW/cm²のもとで10分間露光を行った。協和界面科学株式会社製CONTACT-ANGLE METER CA-Dを用いて空中水滴法で表面の接触角を測定したところ露光部 50

5度、非露光部51度を得た。

【0046】この版を、サクライ社製オリバー52片面 印刷機にセットし、湿し水を純水、インキを大日本イン キ化学工業社製New ChampionF グロス85墨を用いて1000枚オフセット印刷を行った。スタートから終了まで非画像部に汚れのない鮮明な印刷物が得られ、印刷版 の損傷も認められなかった。

【0047】実施例3

実施例1と同様にして陽極酸化処理したアルミニウム支持体をCsLa、NbTi、Onの化学量論比に相当するセシウムエトキシド、チタンプトキシド、テンタンイソプトキシド、ニオブエトキシドを含む20%のエタノール溶液に浸漬して表面を加水分解したのち200°C以上に加熱してアルミニウム支持体表面にCsLa、NbTi、Onの厚み1000オングストロームの薄膜を形成させた。

【0048】この複合金属酸化物薄膜付きアルミニウム支持体をサイズは510×400mmにカットしてサンブルとした。この表面にポジの画像を有するリスフィルム20原稿を置き、上から石英ガラス板で機械的に密着させた。これにウシオ電気社製USIO焼き付け用光源装置ユニレックURM-600形式GH-60201Xを用いて、光強度25mW/cm²のもとで5分間露光を行った。協和界面科学株式会社製CONTACT-ANGLE METER CA-Dを用いて空中水滴法で表面の接触角を測定したところ露光部10度、非露光部60度を得た。

【0049】この版を、サクライ社製オリバー52片面 印刷機にセットし、湿し水を純水、インキを大日本イン キ化学工業社製New Champion F グロス85 墨を用いて 500枚オフセット印刷を行った。スタートから終了まで非画像部に汚れのない鮮明な印刷物が得られ、印刷版 の損傷もみとめられなかった。

【0050】実施例4

実施例3における陽極酸化処理したアルミニウム支持体を厚さ100ミクロンのステンレス板支持体に代えた外は、実施例3と同様にCsLa、NbTi、O10の化学量論比に相当するセシウムエトキシド、チタンプトキシド、ランタンイソブトキシド、ニオブエトキシドを含む20%のエタノール溶液に浸漬して表面を加水分解したのち200°C以上に加熱してステンレス支持体表面にCsLa、NbTi、O10の厚み1000オングストロームの薄膜を形成させた。

【0051】この複合金属酸化物薄膜付きアルミニウム 支持体をサイズは510×400mmにカットしてサンプルとした。この表面にポシの画像を有するリスフィルム 原稿を置き、上から石英ガラス板で機械的に密着させた。これにウシオ電気社製USIO焼き付け用光源装置ユニレックURM-600形式GH-60201Xを用いて、光強度25mW/cm³のもとで5分間露光を行った。協和界面科学株式会社製CONTACT-ANCLE METER CA-Dを用い

て空中水滴法で表面の接触角を測定したところ露光部1 0度、非露光部60度を得た。

【0052】この版を、サクライ社製オリバー52片面 印刷機にセットし、湿し水を純水、インキを大日本イン キ化学工業社製New Champion F グロス85塁を用いて 500枚オフセット印刷を行った。スタートから終了まで非画像部に汚れのない鮮明な印刷物が得られ、印刷版 の損傷もみとめられなかった。

実施例5

実施例1と同様にして作製した印刷用原板試料に、水冷 10型アルゴンイオンレーザーの363.8nm光をビーム幅35ミクロン(1/e¹値)に絞り、走査ビッチ22.5ミクロンでレーザー画像を露光した。協和界面科学株式会社製CONTACT-ANGLE METER CA-Dを用いて空中水

滴法で表面の接触角を測定したところ露光部7度、非露 光部62度を得た。

14

【0053】との版を、サクライ社製オリバー52片面印刷機にセットし、湿し水を純水、インキを大日本インキ化学工業社製New Champion Fグロス85墨を用いて500枚オフセット印刷を行った。スタートから終了まで非画像部に汚れのない鮮明な印刷物が得られ、印刷版の損傷もみとめられなかった。

【発明の効果】表面に前記した光触媒型金属酸化物を主成分とする薄層を有する本発明の印刷原板は、活性光による印刷版への像様露光のみで印刷画面が形成され、未露光部にインクを受容させて印刷を行うことによって、現像液が不要で、かつ印刷面の鮮明性が保たれたオフセット印刷が可能となる。